

## 中国・上海硅産業集団股份有限公司への資本参加について

株式会社G S I クレオス（東京都千代田区／代表取締役社長 吉永直明 以下当社）は、半導体前工程（ケイ素材料業界および集積回路業界）への投資を中心業務とする上海硅産業集団股份有限公司（中国上海／董事長 俞躍輝 National Silicon Industry Group Co., Ltd. 以下 NSIG）の第三者割当増資を引き受け、増資後発行済み株式の0.49%（出資金額は31,759千元(約5.2億円)）を3月29日に取得しました。同社傘下企業との事業提携関係を強化し、日本および中国における当社半導体関連事業の拡大を目指します。

NSIG は中国の国有資産を主として2015年12月に設立した会社です。傘下企業は中国や欧州市場を中心とするハイエンドの半導体ウェハメーカーや集積回路材料メーカーで構成されており、世界で高いシェアを占めています。

当社では、中期経営計画において半導体材料・部材を成長事業のひとつに位置づけており、国内外市場における拡販に取り組んでいます。この度の資本参加を通じて、当社はNSIGとの事業提携関係により販売強化を図り、同社が得意とするSOIウェハ（Silicon-On-Insulator Wafer）およびエピタキシャル・ウェハ（Epitaxial Wafer）の日本国内における供給力を高めるとともに、中国に向けた原材料、製造装置販売などの半導体関連事業の拡大に取り組んでいきます。

## 【NSIG 概要】

会社名称	上海硅産業集団股份有限公司 (National Silicon Industry Group Co., Ltd.)
登録住所	中華人民共和国上海市嘉定区
法人代表者	俞躍輝 董事長
登録資本金	1,860,191,800 元
発行済み株式数	1,860,191,800 株
設立日	2015年12月9日

以 上

&lt; 本件に関するお問い合わせ &gt;

株式会社G S I クレオス 経営企画部 企画広報課 Tel 03-5211-1802 牛、小野